# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-109389

(43) Date of publication of application: 09.05.1991

(51)Int.CI.

CO7F 7/08

(21)Application number : **01-247710** 

(71)Applicant : HITACHI CHEM CO LTD

(22) Date of filing:

22.09.1989

(72)Inventor: SASAKI AKIHIRO

KIKUCHI NOBURU

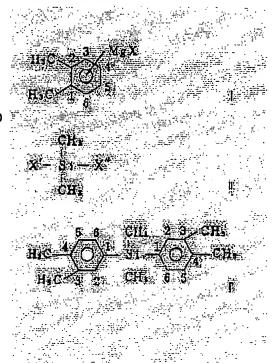
**FUJITA TOSHIYUKI** 

# (54) PRODUCTION OF BIS(3,4-DIMETHYLPHENYL) DIMETHYLSILANE

## (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the title compound useful as a precursor of raw material, etc., for polyimide resin without using a Li compound in high purity and yield by subjecting a Grignard reagent of halogenoorthoxylene to coupling reaction with a dimethyldihalogeno silane. CONSTITUTION: A Grignard reagent of halogenoorthoxylene expressed by formula I (X is halogen: MgX is bonded to the 3- or 4-position) is subjected to coupling reaction with a dimethyldihalogenosilane (e.g. dimethyldichlorosilane) expressed by formula II (X' and X" are halogen), preferably at a molar ratio of 1:0.4-0.5 at 20-60°C for 1-5hr to provide the aimed compound expressed by

formula III. Furthermore, after coupling reaction, the



aimed compound is further preferably subjected to separation by recrystallization using 1-4C alcohol.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### ⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-109389

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)5月9日

C 07 F 7/08

C 8018 - 4H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

の発明の名称 ピス(3,4ージメチルフエニル)ジメチルシランの製造法

願 平1-247710

願 平1(1989)9月22日

個発 明 者 佐々木 頭浩 茨城県日立市東町 4 丁目13番 1 号 日立化成工業株式会社 茨城研究所内

烟発 明 官 茨城県日立市東町4丁目13番1号 日立化成工業株式会社 茨城研究所内

烟発 明 利之 茨城県日立市東町4丁目13番1号 日立化成工業株式会社 山崎工場内

勿出 願 人 日立化成工業株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

弁理士 若林 四代 理 人 邦彦

一般式(四)

1. 発明の名称

ピス ( 3.4 - ジメテルフエニル ) ジメテルシラ ンの製造法

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 式[]]

で示されるビス(34-ジメチルフエニル)ジメ チルシランを製造するに当り。

一般式[]]

(ただし、式中Xはハロゲン原子を示し、MgX は、3又は4位に結合している)で示されるハロ ゲノオルトキシレンのグリニヤール試楽と

CH: 

(ただし、式中X'及びX'はハロゲン原子を示す) で示されるジメチルジハロゲノシランとをカツブ リング反応させることを特徴とするピス(34-ジメチルフエニル)ジメチルシランの製造法。

2. カップリング反応後。さらに炭素原子数1. ~4 のアルコールを用いて再結晶分離する請求項 1 記載のピス(3.4 - ジメチルフエニル)ジメチ ルシランの製造法。

3. 発明の詳細な説明

( 産業上の利用分野)

本発明は、ポリイミド樹脂の原料等として有用 な式 [V]

で示されるピス(3.4ージカルボキシフェニル) ジメチルシラン二無水物の前駆体であるピス(3.4ージメチルフエニル)ジメチルシランの製造法 に関する。

#### (従来の技術)

從来, 式[1]

で示されるピス(3.4 - ジメチルフェニル)ジメ チルシランの製造方法としてジャーナル オブ オ ーガニンク ケミストリー (J. Org. Chem.) 第38巻4271ページ(1973年)に記載さ れている Pratt らの方法が知られており。これ は、次の反応式(Y)によつて示される。

を用いて作業性よく、高純废高収率でピス(3.4 ~ ジメチルフエニル) ジメチルシランを得る方法 を提供するものである。

(課題を解決するための手段)

本発明は、式[1]

で示されるピス(3.4 - ジメナルフエニル)ジメ ナルシランを製造するに当り。

#### 一般式(1)

$$\begin{array}{c|c}
H_1C & 2 & 3 \\
 & 4 & 4 \\
H_1C & 1 & 6 & 5
\end{array}$$
(II)

(ただし。式中Xは、ハロゲンを示し。 MgXは、3 又は 4 位に結合している) で示されるハロゲノオルトキシレンのグリニヤールは楽と

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_{3} \\
\text{C} \ell - \text{S}_{1} - \text{C} \ell \\
\text{CH}_{3} \\
\text{CH}_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_{3} \\
\text{S}_{1} \\
\text{CH}_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_{3} \\
\text{CH}_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_{3} \\
\text{CH}_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_{3} \\
\text{CH}_{3}
\end{array}$$

すなわち。4 - プロモーオルトーキシレンをn -プチルリチウムと反応させ、リチウム化合物とし、 これにジクロロジメチルシランを反応させ、ビス (34 - ジメチルフエニル) ジメチルシランとす る方法である。

#### (発明が解決しようとする課題)

上述の Prait らの方法では、リチウム化合物 を用いてピス(3.4 ージメチルフェニル)ジメチ ルシランを得ているが、この時用いるnープチル リチウムは、水分等に対して反応性が非常に大き く、発火性が高いため通常nーへキサンに希釈し た潜放として用いることが多い。このため、工薬 的利用には制限がありあつかいにくい材料である。

本発明は、高価であつかいにくいリチウム化合 物を用いることなく、代わりに汎用の安価な原料

$$X' - S_i - X'$$

(ただし、式中X'及び X"は、ハロゲンを示す) で示されるジメチルジハロゲノシランとをカップ リング反応させることを特徴とするビス(34~ ジメチルフェニル)ジメチルシランの製造法に関 する。

また、本発明は、上記のカップリング反応させた後、さらに炭素原子数1~4のアルコールを用いて再結晶分離することを特徴とするピス(3.4 ージメテルフエニル)ジメチルシランの製造法に関する。

本発明を以下、詳細に説明する。

ハロダノーオルトーキシレンとしては、4-日ードーオルトーキシレン、4ープロモーオルトーキシレン・サンシ、4ープロモーオルトーキシレン等があり、これらは単独で使用しても2種以上併用して もよく、4ープロモーオルトーキシレンが好ましい。なお、4ープロモーオルトーキシレンは、企 成上単品で得るととは不可能であり、所望しない 3 - プロモーオルトーキシレンを含むものである。 ハロゲノーオルトーキシレンをグリニヤール試

楽とする方法は、常法により行なりととができる。

. 5

例えば、ハロダノーオルトーキシレン1.0モルに対して、1.0グラム原子以上の金属マグネシウムを用いてグリニャールは寒とする。金属マグネシウムが1.0グラム原子未満の場合、未反応のハロゲノーオルトーキシレンが残存するので好ましくない。グリニャールは楽とする際の反応温度は0℃以上で辞媒のリフラックス温度以下で行ない。反応時間は通常1~10時間である。

反応に用いた金属マグネンウムの量が、ハロゲノーオルトーキシレン 1.0 モルに対して、1.0 グラム原子を越える場合、未反応の金属マグネシウムが残るが、これは濾過して除く。このときに使用される溶媒としてはエチルエーテル、テトラヒドロフラン等がある。

ジメチルハロゲノシランとしては、ジメチルジ クロロシラン、ジメチルジプロモンラン等があげ

超えて高い場合。ポリンラン化合物などの高沸点 成分などの副生物が多くなりやすい。

カップリング反応終了後、水を加えることによ つて、カップリング反応で生成したハログン化マ グネシウムを、水に溶解させ、有機層と分離する ことにより容易に除去することができる。

その後、エチルエーテル、テトラヒドロフラン 等を辞媒とする有极層を水洗してハロゲン化マグ オンウムを完全に除き、エパポレーターによつて 有機溶媒を除去することによつて式〔1〕で示され るピス(3.4 - ジメチルフエニル)ジメチルシラ ンを含む下記一般式〔N〕で示される具性体混合物 を得る。

(ただし、式中、ケイ業は、各々独立して3叉は 4位に結合している)

式[1]で示されるピス(34-ジメチルフエニ

られ、これをグリニャール試薬に加えることでカ ップリング反応が逃行する。

ジメナルジハロゲノシランの使用低は、ハロゲ ノーオルトーキシレンのグリニヤール試果 1.0 モ ルに対して 0.4 ~ 0.5 モル用いることが好ましい。 0.4 モル未満の場合、カツブリング反応における 収率が低下しやすくなる。

0.5 モルを超える場合。キシレコルジメチルハロゲノシランが生成し、最終的にジシロキサン化合物となり、式[1]化合物を精製する際に不純物として混入する。

とのよりな欠点を少なくするためには、ジメデルハロゲノションの使用量は、ハロゲノーオルトーキシレンのグリニヤール試楽 1.0 モルに対して 0.45~0.50 モルがより好ましく、0.5 モルが最も好ましい。

カップリング反応は、20~60℃で行なうのが好ましく。反応時間は通常1~5時間である。 反応温度が低い場合は反応時間が長くなるだけで、 本質的問題とはならないが。反応温度が60℃を

ル) ジメチルシランを含む一般式 (N) で示される 異性体混合物から目的の式[1]で示されるピス (34-ジメチルフエニル) ジメチルシランを分 離するために,炭素原子数1~4のアルコールを 用いて再結晶を行なり。用いるアルコールとして は、メタノール、エタノール、プロパノール、イ ソプロパノール、ブタノール、イソプタノール。 ターシャリーブタノール等があり、メタノールが 好ましい。 アルコールの量は、 混合物の 2~4倍 重量の範囲が好ましく,3倍重量がより好ましい。 アルコールが少たい場合、目的の式[1]で示され るピス(34ージメチルフ エニル)ジメチルシラ ン (理論量 5 6.2 5 %)以外に、その異性体であ る(23-ジメチルフエニル)(3.4-ジメチル フエニル)ジメチルシラン(理論量37.5%)及 びピス(23ージメチルフエニル)ジメチルシラ ン(環論量 6.2 5 多)が析出する。また。アルコ ールが多すぎると、潜解性が高くなりすぎて、再 結晶で析出する目的物の式[i]の化合物のピス

(34-ジメナルフエニル)ジメチルシランの抗

が少たくたる。

. \$

本発明におけるビス(3.4 - ジメチルフエニル)
ジメチルシランは、ビス(3.4 - ジカルボキシフ
エニル) ジメチルシラン二無水物 (前配式 [V] で
示される) の前配体である。 腋二無水物は、ボリ
イミド樹脂その他樹脂の原料等として有用である。
(実施例)

#### (1) グリニヤール試楽の製造

アリーン冷却器。 滴下ロート、温度計及び捷拌 接て取付けた 2 世四つロフラスコをアルゴンガス 外側気下で十分乾燥させたのち。 金属ナトリウムで脱水したテトラヒドロフラン100㎡、金属マグネシウム 9.72 g 及びブロモーオルトーキシレン 10.0 g を加えた。 反応被がにどり始めて、グリニャールは薬が生以し始めたとき、 滴 マート から上記と同一のプロモーオルトーキシレン 640 gを1時間かけて滴下した。 この間、 発熱反応であるので氷浴で冷却したがら反応温度を40℃に

メチルフエニル) ジメチルションが9 4.5 面積 % 含まれ、他に創生成物として、商沸点成分が8.5 面積 %含まれていた。

#### (3) 分離精製

上記で得られたビス(ジメチルフェニル)ジメチルシラン51g(理論的には56.25重量を(ブロモーオルトーキシレン中の4ープロモーオルトーキシレンは75%であり0.75×0.75×100=56.25)のビス(3.4ージメチルフェニル)ジメチルシランを含む)を500ペナス双フラスコに入れ、これにメタノール153gを加え、加熱リフラックスさせて溶解した後、熱時により、加熱リフラックスさせて溶解した後、熱時によりでである。

この結晶を戸過して取り出し、乾燥させたところ重量は 2.6.5 g であり、分離精製の収率は 9.2.4 がであつた [ 2.6.5 g / ( 5.1 g  $\times$  0.5 6.2.5 )]。また、融点は  $5.8 \sim 5.9$  でであつた。この値は、ジャーナル オブ オーガニック ケミストリー (J. Org. Chem.) 第 3.8 卷 4.2.7 1 ページ

保つた。 橋下終了後も金属マクネシウムが残つているので、オイルパスで加熱し、温度40℃のまま5時間提拌し、金属マグネシウムを完金に反応させグリニヤール試楽とした。

#### (2) カップリング反応

次に商下ロートからジメチルジクロロション 25.81g(0.20モル)を20分間かけて該下 した。この間反応温度を20℃に保ち,滴下終了 後もさらに5時間20℃に保つたままカップリン グ反応を完結させた。

上記の反応液にトルエン300㎡を加え。提作したがらイオン交換水250㎡を1時間かけて徐々に加えた。下暦の水暦を分被ロートで除去したのち、上暦のテトラヒドロフランとトルエンを溶媒とする有機層を2重量をの膜限ナトリウム水溶液100㎡で3回洗浄したのち、エパポレーターで溶媒を除去し、51gのピス(ジメチルフエニル)ジメチルションを得た。

とれを示整屈折計を取付けたグルパーメーショ ンクロマトグラフィーで分析したところピス (ジ

(1973年) に記載されている値(54~56 で) にほぼ一致した。また、プロトン NMR 分析 し、前記白色の結晶がピス(34-ジメテルフェ ニル) ジメテルシランであることを確認した。

また、このものの純度は99.0モルガ以上であった(デュポン社製9900型熱分析装置でDSC 例定を行ないファウントホッフの式により算出)。

#### (発明の効果)

本発明によれば、ビス(34ージメチルフェニル)ジメチルシランを安価な汎用原料を用いて、 作業性よく、高純度高収率で得ることができる。

代理人 弁理士 若 林 邦 彦